

Tabela nr 1. Emisja dopuszczalna z procesów malowania - inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, włókien, folii lub papieru w instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych – WARANT I – destylacja rozpuszczalników z mycia pistoletów natryskowych

Źródła powstawania emisji substancji do powietrza	Miejsca wprowadzania substancji do powietrza			Urządzenia ograniczające wielkość emisji	Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [mg/m ³ uj.]
	nr emitora	wysokość [m]	średnica lub wymiar wyłotu [m]			
Linia malowania zanurzeniowego i natryskowego (KTL+L-1)						
Wanna do malowania na linii KTL	KTL/1	13,2	0,6	brak	lotne związki organiczne	150
Wanna do malowania na linii KTL	KTL/2	12,8	0,5	brak	lotne związki organiczne	150
Suszarka po malowaniu na linii KTL	KTL/3	13,1	0,4	brak	lotne związki organiczne	150
Suszarka po malowaniu na linii KTL	KTL/4	13,0	0,3	brak	lotne związki organiczne	150
Kabina malowania na linii L-1	L/1	32,0	1,8	brak	lotne związki organiczne	150
Kabina malowania na linii L-1	L/2	32,0	1,8	brak	lotne związki organiczne	150
Tunel podsuszania na linii L-1	L/3	13,1	0,4	brak	lotne związki organiczne	150
Tunel podsuszania na linii L-1	L/4	13,1	0,4	brak	lotne związki organiczne	150
Tunel podsuszania na linii L-1	L/5	13,1	0,4	brak	lotne związki organiczne	150
Suszarka po malowaniu na linii L-1	L/6	13,0	0,35	brak	lotne związki organiczne	150
Suszarka po malowaniu na linii L-1	L/7	13,0	0,35	brak	lotne związki organiczne	150
Mieszalnia farb na linii L-1	L/8	13,0	0,8	brak	lotne związki organiczne	150
Linia malowania natryskowego L-2						
Kabina malowania na linii L-2	L2/1	32,0	1,8	brak	lotne związki organiczne	150
Kabina malowania na linii L-2	L2/2	32,0	1,8	brak	lotne związki organiczne	150
Suszarka po malowaniu na linii L-2	L2/3	13,1	0,5	brak	lotne związki organiczne	150
Suszarka po malowaniu na linii L-2	L2/4	13,1	0,5	brak	lotne związki organiczne	150
Mieszalnia farb na linii L-2	L2/7	11,9	0,4	brak	lotne związki organiczne	150

Źródła powstawania substancji do powietrza	Miejsca wprowadzania substancji do powietrza			Urządzenia ograniczające wielkość emisji	Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [mg/m ³ /J]
	nr emitora	wysokość [m]	średnica lub wymiary wylotu [m]			
Linia malowania natryskowego L-3						
Mieszalnia farb na linii L-3	L3/2	10,6	0,32	brak	lotne związki organiczne	150
Tunel podsuzan a na linii L-3	L3/3	10,4	0,4	brak	lotne związki organiczne	150
Suszarka po malowaniu na linii L-3	L3/5	10,8	0,4	brak	lotne związki organiczne	150
Suszarka po malowaniu na linii L-3	L3/6	11,0	0,4	brak	lotne związki organiczne	150
Kabina malowa na linii L-3	L3/8	13,8	1,26	brak	lotne związki organiczne	150
Stanowisko nanoszenia poprawek malarskich hedera						
Malowanie na stanowisku poprawek malarskich hedera	H/1	6,0	0,4	adsorber węglowy	lotne związki organiczne	150
Malowanie na stanowisku poprawek malarskich hedera	H/2	6,0	0,4	adsorber węglowy	lotne związki organiczne	150
Suszarka po malowaniu na stanowisku poprawek malarskich hedera	H/3	6,0	0,25	brak	lotne związki organiczne	150
Suszarka po malowaniu na stanowisku poprawek malarskich hedera	H/4	6,0	0,25	brak	lotne związki organiczne	150
Malowanie na stanowisku poprawek malarskich hedera	H/5	6,0	0,4	adsorber węglowy	lotne związki organiczne	150
Linia malowania natryskowego L-4						
Kabina malowa na linii L-4	L4/1	13,0	1,11	brak	lotne związki organiczne	150
Kabina malowa na linii L-4	L4/2	13,0	1,11	brak	lotne związki organiczne	150
Kabina malowa na linii L-4	L4/3	13,0	1,11	brak	lotne związki organiczne	150
Kabina malowa na linii L-4	L4/4	13,0	1,11	brak	lotne związki organiczne	150
Mieszalnia farb na linii L-4	L4/5	13,0	0,5	brak	lotne związki organiczne	150
Suszarka po rowaniu	L4/7	14,0	0,25	brak	lotne związki organiczne	150

* steżenie lotnych związków organicznych w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny, odniesione do warunków umownych, tj. w gazie suchym, w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa.

Tabela nr 2. Emisja dopuszczalna z procesów malowania - inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, włókien, folii lub papieru w instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych – VARIANT II – brak destylacji rozpuszczalników z mycia pistoletów natryskowych

Źródła powstawania emisji substancji do powietrza	Miejsca wprowadzania substancji do powietrza		Urządzenia ograniczające wielkość emisji	Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [mg/m ³] [*]
	nr emitora	wysokość [m]			
Linia malowania zanurzeniowego i natryskowego (KTL+L-1)					
Wanna do malowania na linii KTL	KTL/1	13,2	0,6	brak	lotne związki organiczne
Wanna do malowania na linii KTL	KTL/2	12,8	0,5	brak	lotne związki organiczne
Suszarka po malowaniu na linii KTL	KTL/3	13,1	0,4	brak	lotne związki organiczne
Suszarka po malowaniu na linii KTL	KTL/4	13,0	0,3	brak	lotne związki organiczne
Kabina malowania na linii L-1	L1/1	32,0	1,8	brak	lotne związki organiczne
Kabina malowania na linii L-1	L1/2	32,0	1,8	brak	lotne związki organiczne
Tunel podsuszania na linii L-1	L1/3	13,1	0,4	brak	lotne związki organiczne
Tunel podsuszania na linii L-1	L1/4	13,1	0,4	brak	lotne związki organiczne
Tunel podsuszania na linii L-1	L1/5	13,1	0,4	brak	lotne związki organiczne
Suszarka po malowaniu na linii L-1	L1/6	13,0	0,35	brak	lotne związki organiczne
Suszarka po malowaniu na linii L-1	L1/7	13,0	0,35	brak	lotne związki organiczne
Mieszalnia farb na linii L-1	L1/8	13,0	0,8	brak	lotne związki organiczne
Linia malowania natryskowego L-2					
Kabina malowania na linii L-2	L2/1	32,0	1,8	brak	lotne związki organiczne
Kabina malowania na linii L-2	L2/2	32,0	1,8	brak	lotne związki organiczne
Suszarka po malowaniu na linii L-2	L2/3	13,1	0,5	brak	lotne związki organiczne

Źródła powstawania emisji substancji do powietrza	Miejsca wprowadzania substancji do powietrza			Urządzenia ograniczające wielkość emisji	Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [mg/m ³ u] [*]
	nr emitora	wysokość [m]	średnica lub wymiary wylotu [m]			
Suszarka po malowaniu na linii L-2	L2/4	13,1	0,5	brak	lotne związki organiczne	50
Mieszalnia farb na linii L-2	L2/7	11,9	0,4	brak	lotne związki organiczne	75
Linia malowania natryskowego L-3						
Mieszalnia farb na linii L-3	L3/2	10,6	0,32	brak	lotne związki organiczne	75
Tunel podsuszania na linii L-3	L3/3	10,4	0,4	brak	lotne związki organiczne	50
Suszarka po malowaniu na linii L-3	L3/5	10,8	0,4	brak	lotne związki organiczne	50
Suszarka po malowaniu na linii L-3	L3/6	11,0	0,4	brak	lotne związki organiczne	50
Kabina malowania na linii L-3	L3/8	13,8	1,26	brak	lotne związki organiczne	75
Stanowisko nanoszenia poprawek malarskich hedera						
Malowanie na stanowisku poprawek malarskich hedera	H/1	6,0	0,4	adsorber węglowy	lotne związki organiczne	75
Malowanie na stanowisku poprawek malarskich hedera	H/2	6,0	0,4	adsorber węglowy	lotne związki organiczne	75
Suszarka po malowaniu na stanowisku poprawek malarstw hedera	H/3	6,0	0,25	brak	lotne związki organiczne	50
Suszarka po malowaniu na stanowisku poprawek malarstw hedera	H/4	6,0	0,25	brak	lotne związki organiczne	50
Malowanie na stanowisku poprawek malarskich hedera	H/5	6,0	0,4	adsorber węglowy	lotne związki organiczne	75
Linia malowania natryskowego L-4						
Kabina malowania na linii L-4	L4/1	13,0	1,11	brak	lotne związki organiczne	75
Kabina malowania na linii L-4	L4/2	13,0	1,11	brak	lotne związki organiczne	75
Kabina malowania na linii L-4	L4/3	13,0	1,11	brak	lotne związki organiczne	75
Kabina malowania na linii L-4	L4/4	13,0	1,11	brak	lotne związki organiczne	75

Źródła powstawania emisji substancji do powietrza	Miejsca wprowadzania substancji do powietrza			Urządzenia ograniczające wielkość emisji	Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [mg/m ³ uj.]
	nr emitora	wysokość [m]	średnica lub wymiary wylotu [m]			
Mieszalnia farb na linii L-4	L4/5	13,0	0,5	brak	lotne związki organiczne	75
Suszarka po malowaniu	L4/7	14,0	0,25	brak	lotne związki organiczne	50

* stężeń lotnych związków organicznych w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny, odniesione do warunków umownych tj. w gazie suchym, w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa.

Tabela nr 3. Dopuszczalna emisja niezorganizowana z procesów malowania - inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, włókien, folii lub papieru w instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, wyrażona jako procent wsadu LZO

Źródło powstawania/ miejsce wprowadzania substancji do powietrza	Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [%]
Procesy malowania – inny rodzaj powlekania metali, tworzyw sztucznych, tkanin, włókien, folii lub papieru w instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych	lotne związki organiczne	20

Tabela nr 4. Emisja dopuszczalna dla pozostałych procesów w instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych – dla obydwu wariantów

Źródła powstawania emisji substancji do powietrza	Miejsca wprowadzania substancji do powietrza			Urządzenia ograniczające wielkość emisji	Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
	nr emitora	wysokość [m]	średnica lub wymiary wylotu [m]			
Linia malowania natryskowego L-2						
Agregat suszarki po malowaniu na linii L-2	L2/5	13,2	0,25	brak	pył ogółem pył zawieszony PM10	0,00035 0,00035

Źródła powstawania emisji substancji do powietrza	Miejsca wprowadzania substancji do powietrza			Urządzenia ograniczające wielkość emisji	Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
	nr emitora	wysokość [m]	średnica lub wymiary wyłotu [m]			
Agregat suszarki po mowaniu na linii L-2	L2/6	13,2	0,25	brak	pył zawieszony PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00035 0,00187 0,02987 0,0084
Kocioł grzewczy o mocy 370 kW	L2/8	12,0	0,3	brak	pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu tlenek węgla	0,00002 0,00002 0,00002 0,00315 0,00599 0,01182
Linia malowania natryskowego L-3						
Agregat suszarki po myciu elementów na linii L-3	L3/1	11,0	0,49	brak	pył ogółem pył zawieszony PM10 pył zawieszony PM2,5 dwutlenek siarki dwutlenek azotu	0,00024 0,00024 0,00024 0,0013 0,02084

Źródła powstawania emisji substancji do powietrza	Miejsca wprowadzania substancji do powietrza			Urządzenia ograniczające wielkość emisji	Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
	nr emitora	wysokość [m]	średnica lub wymiary wyłotu [m]			
Agregat suszarki do podgrzewania roztworów linii L-3	L3/4	11,6	0,35	brak	tlenek węgla	0,00586
					pył ogółem	0,00016
					pył zawieszony PM10	0,00016
					pył zawieszony PM2,5	0,00016
					dwutlenek siarki	0,00083
	L3/7	11,6	0,35	brak	dwutlenek azotu	0,01331
					tlenek węgla	0,00374
					pył ogółem	0,00016
					pył zawieszony PM10	0,00016
					pył zawieszony PM2,5	0,00016
Agregat suszarki do podgrzewania roztworów linii L-3	L4/6	13,0	0,25	brak	dwutlenek siarki	0,00083
					dwutlenek azotu	0,01331
					tlenek węgla	0,00374
					pył ogółem	0,00043
Agregat suszarki po malowaniu linii L-4	L4/8	13,0	0,25	brak	pył zawieszony PM10	0,00043
					pył ogółem	0,00043

Linia malowania natryskowego L-4

Agregat suszarki po malowaniu linii L-4	L4/6	13,0	0,25	brak	pył ogółem	0,00043
					pył zawieszony PM10	0,00043
					pył zawieszony PM2,5	0,00043
					dwutlenek siarki	0,0023
					dwutlenek azotu	0,03680
Agregat suszarki po malowaniu linii L-4	L4/8	13,0	0,25	brak	tlenek węgla	0,01035
					pył ogółem	0,00043

Źródła powstawar a emisji substancji do powietrza	Miejsca wprowadzania substancji do powietrza			Urządzenia ograniczające wielkość emisji	Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
	nr emitora	wysokość [m]	średnica lub wymiary wyłotu [m]			
				pył zawieszony PM2,5		0,00043

Tabela nr 5. Roczne wielkości emisji substancji dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych – dla obu wariantów

	Rodzaj instalacji	Substancje wprowadzane do powietrza	Emisja roczna [Mg/rok]
Instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych	lotne związki organiczne	221,463	
Instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych	pył ogółem	0,01607	
Pozostałe procesy	pył zawieszony PM10	0,01607	
	pył zawieszony PM2,5	0,01607	
	dwutlenek siarki	0,10840	
	dwutlenek azotu	1,40092	
	tlenek węgla	0,46992	

Tabela nr 6. Odpady dopuszczone do wytwarzania

Lp.	Rodzaj odpadu [Podstawowy skład chemiczny i właściwości]	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok] WARIANT I (z destylacji)	WARIANT II (bez destylacji)	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadu
1.	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) [Węgiel aktywny składa się głównie z węgla piemiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę). Odpad zawiera również rozpuszczalniki organiczne zaabsorbowane przez węgiel - węglowodory alifatyczne, ksylen, toluen, octan butylu, etylobenzen. Właściwości: ciało stałe, drobnoziarnisty proszek, HP3-B- łatwopalne]	06 13 02*	5,5	5,5	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu Terminala Odpadów w wiacie F. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
2.	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne [przeterminowane, zanieczyszczone, nienadające się do wykorzystania materiały lakiernicze, zawierające: solvent nafta, etylobenzen, mieszankę wosku . Właściwości: nienadające się do wykorzystania materiały lakiernicze - ciecz, H3-A- wysoce łatwopalne lub H3-B - łatwopalne; suche odpady polakiernice z czyszczenia instalacji - ciało stałe - HP3-A- wysoce łatwopalne lub HP3-B - łatwopalne; HP14-ekotoksyczne]	08 01 11*	300,0	300,0	Odpad magazynowany w szczelnych, oznakowanych pojemnikach (w tym oryginalnych opakowaniach), odpornych na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu Terminala Odpadów w wiacie F. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
3.	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne [mieszanka farb i lakierów powstająca w wyniku czyszczenia instalacji malowania, szlam powstający w wynikuoczyszczania wód obiegowych, w których nie są stosowane koagulanty oraz pozostałość po destylacji zanieczyszczonych rozpuszczalników zawierające: węglowodory alifatyczne, ksylen, toluen, octan butylu, etylobenzen, woda. Właściwości: szlam uwodniony organicznych <1%. Właściwości: szlam uwodniony polakierniczy o zawartości suchej masy 10-40%, odpad niepalny]	08 01 13*	107,0	100,0	Odpad magazynowany w oznakowanych, szczelnych (hermetycznie zamkanych) pojemnikach typu ASP, odpornych na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu Terminala Odpadów w wiacie F. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Lp.	[Podsta vowy skład chemiczny i właściwości]	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok] WARIANT I (z destylacją)	WARIANT II (bez destylacji)	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadu
4.	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 [koagulanty, floculanty, pigmenty, żywice, wypełniacze (węglany), talki, toluen, octan bazy, związki organiczne <1%; Właściwości: szlam polakierniczy o zawartości suchej masy 10-40%, nie posiada właściwości niebezpiecznych, wymienionych w załączniku 3 ustawy o odpadach; odpad niepalny]		08 01 14	700,0	700,0	Odpad magazynowany w oznakowanych, szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych substancji, ustawnionych na utwardzonym, szczelnym podłożu Terminala Odpadów w wiacie F. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
5.	Zmywacz farb uż. lakierów [zanieczyszczenia rozpuszczalniki, nienadające się do regeneracji w estylarce, zawierające: węglowodory alifatyczne, ksylen, toluen, octan butylu, etylobenzen, Właściwości: ciecz w postaci półpłynnej do żelowej, łatwopalny lub wysoce łatwopalny HP3-A lub HP3-B, ekotoksyczny [F14]		08 01 21*	28,58	76,21	Odpad magazynowany w oznakowanych, szczelnych pojemnikach typu IBC, odpornych na działanie przechowywanych substancji, ustawnionych na utwardzonym, szczelnym podłożu Terminala Odpadów w wiacie F. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
6.	Inne oleje silniowe, przekładniowe i smarowe [frakcje destylacyjne ropy naftowej lub ich syntetyczne odpowiedniki (węglowodory aromatyczne), metale ciężkie. Właściwości: ciecz, łatwopalna lub wysoce łatwopalna HP3-A lub HP: -B]		13 02 08*	4,2	4,2	Odpad magazynowany w oznakowanych, szczelnych pojemnikach z metalu (beczkach), ustawnionych na utwardzonym, szczelnym podłożu Terminala Odpadów w wiacie F. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Miejsce magazynowania wyposażone w środki gaśnicze oraz zapas sorbentów do usuwania ewentualnych wycieków. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.

Lp.	Rodzaj odpadu [Podstawowy skład chemiczny i właściwości]	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok] WARIANT I (z destylacją)	WARIANT II (bez destylacji)	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadu
7.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone [tworzywa sztuczne, metale, szkło wraz z niewielkimi ilościami preparatów lakierniczych, zawierających m. in. Węgielwodory, ksylen,toluen,benzen,octan butylu. Właściwości: ciało stałe z zawartością cieczy, zapach charakterystyczny, HP3-A - wysoko łatwopalne, HP14-ekotoksyczne]	15 01 10*	3225,0	3225,0	Odpad magazynowany w szczelnich, oznakowanych pojemnikach lub luźem na utwardzonym, szczelnym podłożu (dotyczy odpadów wielkogabarytowych) Terminala Odpadów w wiacie F. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych. Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
8.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi [węgielwodory alifatyczne, ksylen, toluen, etylobenzen, octan butylu. Właściwości: ciało stałe, mogące zawierać ciecz, HP3-B - łatwopalne lub HP3-A- wysoko łatwopalne]	15 02 02*	125,0	125,0	Odpad magazynowany w szczelnich, oznakowanych pojemnikach (odpornych na działanie przechowywanych substancji), ustawionych na utwardzonym szczelnym podłożu Terminala Odpadów w wiacie F. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
9.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 [szkło, rtęć, sód metale; Właściwości: HP5- szkodliwe, HP7 - rakotwórcze, odpad niepalny]	16 02 13*	2,0	2,0	Odpad magazynowany w pojemnikach lub oryginalnych opakowaniach, ustawionych na terenie Terminala Odpadów w wiacie BC. Odpad magazyinowany w sposób zapobiegający uszkodzeniu (stłuczeniu) oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku.
10.	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne czyszczania ścieków przemysłowych [odwodnione osady powstające w procesie czyszczania substancji procesowych, pochodzących z procesu przygotowania powierzchni przed malowaniem osad o zawartości ok. 40% suchej masy, zawierający m.in.: Zn, Ni, Fe, P. Właściwości: ciało stałe, HP5- szkodliwe, HP14- ekotoksyczne, odpad niepalny]	19 08 13*	500,0	500,0	Odpad magazynowany w szczelnich, oznakowanych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych substancji, ustawionych na utwardzonym szczelnym podłożu Terminala Odpadów w wiacie F. Odpad magazynowany w sposób zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz oddziaływaniu na odpad czynników atmosferycznych. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Lp.	Rodzaj odpadu [Podsta wowy skład chemiczny i właściwości]	Kod odpadu	Ilość odpadu [Mg/rok] WARIANT I (z destylacją)	WARIANT II (bez destylacji)	Miejsce i sposób magazynowania na terenie zakładu oraz sposób dalszego zagospodarowania odpadu
11.	Zużyty węgiel aktywny składa się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częstocie w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, jawnie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę). Właściwości: ciało stałe, bardzo niska reaktywność, ciepłownictwo, cieczownictwo, obnożarnistwo proszek, HP3-B - łatwopalne lub HP3-A- wysoce łatwopalne]	19 09 04	10,0	10,0	Odpad magazynowany w szczelnich pojemnikach (beczkach), ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu Terminala Odpadów w wiacie F. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.
12.	Nasycone lub użyte żywice jonowymienne [kopolimery selektywnego innego, HP3-B - łatwopalne lub HP3-A- wysoce łatwopalne]	19 09 05	4,2	4,2	Odpad magazynowany w szczelnich pojemnikach (metalowych beczkach lub pojemnikach typu ASP), ustawionych na utwardzonym, szczelnym podłożu Terminala Odpadów w wiacie F. Odpad przekazywany uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

z up. Marszałka Województwa
Marcin Podgócki
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
Emisji i Pozwoleni Zintegrowanych